

进口扩散炉 半导体常压扩散工艺

产品名称	进口扩散炉 半导体常压扩散工艺
公司名称	上海驰舰半导体科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Centrotherm 型号:E-2000 用途:半导体常压扩散工艺
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢812、815室
联系电话	86 021 60751826

产品详情

品牌	Centrotherm	型号	E-2000
用途	半导体常压扩散工艺		

centrotherm e 2000系统支持多重工艺功能，满足客户对高产能的需求。同时，e2000系统具有支持的大批量生产达菲易维护，安全可靠的水平炉操作界面。

centrotherm的设计在高效，低运行成本上非常出色，同时也具备了能满足多种工艺需要的灵活性。

工艺：常压工艺

扩散工艺 活化退火工艺

硼掺杂工艺 硅化工艺

磷掺杂工艺 氮化工艺

氢、氧退火工艺 内联烧结工艺

干氧，湿氧氧化【可选：dce，hcl】工艺

特征及优势

多达4个并列石英或sic管反应腔体【最多可达到300mm】

有可自由选择工艺的腔体

全自动cassette-to-cassette传片，wafer直径最大可达200mm

先进的晶圆冷却系统：不同管道间没有热干扰，没有对室内洁净空气的消耗

自动无沾污晶舟传片

模块式部件设计，使设备在洁净室环境下拆与装更容易

工艺数据

晶圆尺寸：150mm【max.200 wafers】

200mm【max.150 wafers】

加热系统：3或5个加热区，900mm至1000mm的 ± 0.5 的恒温区

工艺温度：200 -1300